



МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГнетРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ

МВУ ТМ МАГНА 11,12

Назначение:

Нанесение плёнок металлов, резистивных материалов и диэлектриков методом магнетронного распыления.

Особенности:

- Тип и количество МРУ в установке:
Магна 11 постоянного тока - 2шт.;
Магна 12 постоянного тока - 1 шт., ВЧ - 1шт.
- Обработка подложек в одном технологическом цикле (односторонняя обработка):
Ø 100 мм - 4шт.
Ø 150 мм - 2шт. (на другом подложкодержателе);
- Периодический поворот подложкодержателя на 90°;
- Количество ионных источников - 1шт.;
- Микропроцессорная система управления;
- Безмасляная система откачки (ТМН300);
- Мощность потребления не более 4,5 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой ~ 2,5 м².

